

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年8月19日(2010.8.19)

【公開番号】特開2009-218500(P2009-218500A)

【公開日】平成21年9月24日(2009.9.24)

【年通号数】公開・登録公報2009-038

【出願番号】特願2008-63034(P2008-63034)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/00 (2006.01)

C 08 G 18/65 (2006.01)

C 08 G 101/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 2 F

B 24 B 37/00 L

B 24 B 37/00 P

C 08 G 18/65 F

C 08 G 101:00

【手続補正書】

【提出日】平成22年7月6日(2010.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

基材層上に研磨層が設けられている研磨パッドにおいて、前記研磨層は、開口を有する略球状の連続気泡を含む熱硬化性ポリウレタン発泡体からなり、前記熱硬化性ポリウレタン発泡体は、イソシアネート成分と活性水素基含有化合物とを原料成分として含有し、前記イソシアネート成分は、ジフェニルメタンジイソシアネート及び／又はその変性体を90重量%以上含有し、前記活性水素基含有化合物は、ポリカプロラクトンジオールと、ポリカプロラクトントリオール及び／又はポリカプロラクトンテトラオールとを合計で60～98重量%、かつイソシアネート基と反応する官能基数が3の化合物を15～40重量%含有し、イソシアネート成分と活性水素基含有化合物との合計量に対するイソシアネート基濃度が10～15重量%であり、前記研磨層は、乾燥状態の圧縮率Aと湿潤状態の圧縮率Bの変化率[{(B-A)/A}×100]の絶対値が100以下であることを特徴とする研磨パッド。